

# ダイオキシン類関係

○ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項の規定による特定施設及び同法第8条の規定による排出基準

1 大気基準適用施設（政令第1条別表第1、規則第1条の2別表第1、規則附則第2条附則別表第2）

政令 号番号	特定施設	施設規模	排出基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	
			既設施設 (平成12年1月14日 以前に設置された施設)	新設施設 (平成12年1月15日 以降に設置された施設)
1	焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結炉	原料の処理能力が1時間1トン以上	1	0.1
2	製鋼の用に供する電気炉（鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）	変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上	5	0.5
3	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力が1時間0.5トン以上	10	1
4	アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉	焙焼炉及び乾燥炉にあつては原料の処理能力が1時間あたり0.5トン以上、溶解炉にあつては容量が1トン以上のもの	5	1
5	廃棄物焼却炉（火床面積（廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあつては、それらの合計）が0.5平方メートル以上又は焼却能力（廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあつては、それらの合計）が1時間あたり50キログラム以上のもの）	焼却能力が1時間あたり4,000kg以上	1	0.1
		焼却能力が1時間あたり4,000kg未満2,000kg以上	5	1
		焼却能力が1時間あたり2,000kg未満	10	5

注1) ダイオキシン類対策特別措置法施行の際、既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉（火格子面積2㎡以上又は焼却能力200kg/h以上）及び製鋼用電気炉については、新設施設の排出基準を適用

注2) 排出基準は標準状態に換算した排出ガスによるものとする。

2 水質基準適用施設（政令第1条別表第2、規則第1条の2別表第2）

政 令 号番号	特 定 施 設	排 出 基 準 (pg-TEQ/L)
1	硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	10
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
5	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	10
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	10
7	カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設	10
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設	10
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設	10
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設	10
11	8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。）の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設	10
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設	10
13	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち次に掲げるもの イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設	10

14	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設	10
15	別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設	10
16	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設（廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設）	10
17	フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第1の1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設	10
18	下水道終末処理施設（第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）	10
19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。）	10